

第 37 回 N E D O 研究評価委員会

議事次第

日時：平成 25 年 12 月 4 日（水）13 時 15 分～16 時 15 分

場所：NEDO 2301～2303 会議室

- | | |
|--|-------------|
| I. 開会、委員紹介、資料の確認、研究評価委員会の運営等について | 13：15～13：20 |
| II. 議事 | |
| 1. プロジェクト評価について（説明 8 分、質疑 12 分） 【審議 5 件】 | 13：20～15：00 |
| （中間評価） | |
| ・ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発／①ヒト幹細胞実用化に向けた評価基盤技術の開発 | 13：20～13：40 |
| ・次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発 | 13：40～14：00 |
| ・次世代プリントドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 | 14：00～14：20 |
| （事後評価） | |
| ・超電導技術開発／イットリウム系超電導電力機器技術開発 | 14：20～14：40 |
| ・グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト(グリーン IT プロジェクト) | 14：40～15：00 |
| <休憩 10 分> | |
| 2. プロジェクト評価について（全体説明 10 分） 【書面審議 4 件】 | 15：10～15：20 |
| （中間評価） | |
| ・ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発 | |
| ・次世代材料評価基盤技術開発／有機 E L 材料の評価基盤技術開発 | |
| （事後評価） | |
| ・革新的ガラス溶融プロセス技術開発 | |
| ・エネルギー ITS 推進事業 | |
| 3. 平成 25 年度プロジェクト評価結果取り纏め状況等（前半） | 15：20～15：30 |
| 4. 平成 25 年度追跡調査・評価の実施状況について | 15：30～16：00 |
| 5. 今後の予定 | 16：00～16：15 |
| III. 閉会 | 16：15 |